

문 의	상표디자인심사국 디자인심사정책과	과 장 이인수 042-481-5331 사무관 정부용 042-481-8203
	2016년 9월 20일(화) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 9월 19일(월) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.	

특허청, 패션디자인 보호를 위한 「2016 디자인보호포럼-서울」 개최

- 패션디자이너를 위한 다양한 지식재산권 정보를 제공 -

특허청(청장 최동규)은 (재)서울디자인재단과 공동으로 9월 30일(금) 오후 2시부터 서울 동대문디자인플라자(DDP) 나눔관에서 「2016 디자인 보호포럼-서울(부제 : Fit your Design right!)」을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 패션업계의 최근 모방 실태를 진단하고 대안을 모색하는 한편, 패션업계의 글로벌 진출을 위해 패션디자이너들이 숙지해야 할 지식재산권 정보들을 소개하기 위하여 마련되었다.

주요 내용은 ▲패션디자인의 모방 유형과 원인, 특징 등 실태 분석 ▲패션디자인의 효과적인 권리확보 및 분쟁대응 전략 ▲패션디자인의 트렌드 변화에 따른 법적 이슈 ▲패션디자인 보호에 관한 외국사례 및 대안적 제도 모색 등이며, 해당분야 전문가들의 주제발표와 패널 토의로 진행될 예정이다.

디자이너, 학생, 기업 담당자 등 패션디자인의 권리보호에 관심있는 사람이라면 누구나 디자인맵(designmap.or.kr)을 통해 무료로 참가 신청할 수 있으며, 현장에서 패션디자인 권리보호에 관한 다양한 의견을 청취하고, 질의응답을 통해 궁금증도 해소한다.

특허청 최규완 상표디자인심사국장은 ‘이번 포럼을 통해 최근 패션 업계의 일부 무분별한 모방 행위에 대해 경각심을 불러 일으키고, 패션 디자이너들이 지식재산권을 올바르게 인식함으로써 패션업계의 건전한 창작 생태계 구성에 도움이 되기를 바란다’ 고 밝혔다.

한편, 특허청은 하반기에도 광주디자인센터, 대구경북디자인센터 및 부산디자인센터와 함께 지역 순회포럼을 개최하여 디자인 권리보호 인식을 지속적으로 확산할 예정이다.

copyright©sanghoon Park

2016 디자인 보호포럼 :서울

Fit your Design Right!

주 관 _ 특허청, 서울디자인재단
일 시 _ '16.09.30.(금) 14:00~17:30
장 소 _ 동대문디자인플라자 나눔관
참가비 _ 무료, 디자인맵(designmap.or.kr) 사전신청

Session & Speaker

1/

패션 디자인 카피, 무엇이 문제인가?

모방유형, 원인, 인식 실태 등

석효정 박사 (중앙대학교)

現 중앙대 패션예술학과 강사
前 (주)성유저널 패션비즈니스, 뉴욕 자일리스트
前 미국 Lord & Taylor co, Avlyn inc 근무

2/

패션 디자인 프로세스별 지식재산권 요소의 검토

독점적 지식재산권과 비독점적 공유저작물
디자인 단계에서의 권리화, 타인의 사용에 대한 판단
마케팅판매 단계, IP에 대한 선택과 집중

복병준 변리사 (해움특허)

現 해움국제특허법률사무소 변리사
現 서울디자인재단 패션연결 자문위원
前 리앤록 특허법인 변리사

3/

패션 디자인 법적보호의 딜레마

저작권, 디자인보호법, 부정경쟁방지법의 구별과 한계
법 제도의 장단점을 고려한 IP 활용전략

정부용 사무관/변리사 (특허청)

現 특허청 디자인심사정책과 사무관
前 특허법인 플러스 변리사
前 (주)팅인티페이스 IP 컨설턴트

4/

기술과 패션의 결합에 따른 법률적 쟁점

클라우드 소싱, 3D 프린팅, VR, AR 등을 활용한
디자인 창작과 이에 대한 보호의 문제

김지훈 사무관 (특허청)

現 특허청 복합디자인심사팀 심사관
KAIST 산업디자인 박사
디자인 지식재산권 (안그래픽스) 저자
Stanford Univ. Dschool 방문 연구원

5/

패션디자인 보호의 해외 사례와 분쟁 해결 방안

외국의 패션디자인 보호 방안 사례
분쟁 해결을 위한 조정, 중재 등 대안

이재경 변호사/교수 (건국대학교)

現 건국대 글로벌융합대학 교수
現 한국패션협회(KFA) 법률자문
現 패션디자인연합회(CFDC) 법률자문
前 법무법인 율촌, 경상 변호사

6/

패널 토의 및 질의응답

패널 전체